11 Veröffentlichungsnummer:

0 226 120

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86116772.4

22) Anmeldetag: 02.12.86

(5) Int. Cl.4: **G 03 C 1/76** //C08F20/10

30 Priorität: 13.12.85 DE 3544212

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 24.06.87 Patentblatt 87/26

84 Benannte Vertragsstaaten: BE DE FR GB

(71) Anmelder: Agfa-Gevaert AG Patentabteilung D-5090 Leverkusen 1(DE)

72 Erfinder: Sauerteig, Wolfgang, Dr. Walter-Flex-Strasse 1 D-5090 Leverkusen(DE)

2 Erfinder: Helling, Günter, Dr. In der Hildscheid 16 D-5068 Odenthal(DE)

2 Erfinder: Laivani, Prem, Dipl.-Ing. In den Dehlen 15 D-5090 Leverkusen(DE)

[54] Fotografisches Aufzeichnungsmaterial mit verbesserter Schutzschicht.

(57) Verbesserte fotografische Aufzeichnungsmaterialien enthalten in wenigstens einer Schicht einen alkalilöslichen Abstandshalter sowie eine wasserunlösliche hochmolekulare Verbindung mit wiederkehrenden Einheiten folgender Struktur

worin die Substituenten die in der Beschreibung angegebene Bedeutung haben.

AGFA-GEVAERT

5 Aktiengesellschaft Patentabteilung

D 5090 Leverkusen 1 Jo/m-c

10

Fotografisches Aufzeichnungsmaterial mit verbesserter Schutzschicht

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft ein fotografisches Aufzeichnungsmaterial, das in wenigstens einer Schutzschicht in alkalischen Verarbeitungsflüssigkeiten lösliche Abstandshalter
und zusätzlich hochmolekulare Teilchen, die mit reaktiven
Gruppen substituiert sind, enthält.

Die in den äußeren Schichten fotografischer Aufzeichnungsmaterialien, insbesondere von Silberhalogenid-Aufzeichnungsmaterialien, üblicherweise enthaltenen hydrophilen Kolloide, z.B. Gelatine, führen zu einer Zunahme von Klebrigkeit der Aufzeichnungsmaterialien bei hohen Luftfeuchtigkeiten und höheren Temperaturen, so daß solche Aufzeichnungsmaterialien, beispielsweise nach Verpackung im Stapel, leicht miteinander verkleben. Diese Klebeneigung zwischen verschiedenen Teilen des Aufzeichnungsmaterials bzw. zwischen dem Aufzeichnungsmaterial und anderen Materialien, die mit ihm in Kontakt kommen, führt zu zahlreichen Schwierigkeiten.

Um diese Schwierigkeiten zu beheben, ist es bekannt, die Außenschichten von Aufzeichnungsmaterialien durch Einarbeiten feinpulvriger anorganischer Verbindungen, wie Siliciumdioxid, Magnesiumoxid, Titandioxid oder Calciumcarbonat, oder organischen Verbindungen, wie Polymethylmethacrylat oder Celluloseacetat-propionat, zu mattieren und so ihre Klebrigkeit zu vermindern. 10

Aus der DE-A 2 758 767 ist ein fotografisches lichtempfindliches Material bekannt, das eine äußere lichtunempfindliche Gelatineschicht aufweist, die kolloidale Kieselsäureteilchen einer Größe von 7 bis 120 nm und einen polymeren Latex enthält, dessen Teilchen 30 bis 80 nm groß sind. Diese Gelatineschicht soll dem fotografischen Material eine erhöhte Bruch- und Dimensionsstabilität verleihen.

20

25

15

5

Nachteilig an einem so ausgerüsteten fotografischen Material ist aber, daß die Zusätze die Transparenz der Schichten verringern und insbesondere bei höheren Feuchtigkeiten (z.B. mehr als 85 % r.F.) und Temperaturen um 35 bis 40°C sensitometrisch nachteilige Kontaktflecken beim Aufrollen der Materialien sich nicht vermeiden lassen.

Präformierte alkali- und wasserunlösliche Polymerteilchen mit relativ enger Teilchengrößenverteilung, die sich als 30 Mattierungsmittel für fotografische Schichten eignen, sind gemäß DE-A-29 19 822 durch Suspensionscopolymerisation von Maleinsäureanhydrid und 1-Olefinen erhältlich (DE-OSen

29 19 822 und 31 44 793). Die Teilchen bleiben nach der Verarbeitung des fotografischen Materials auf der Oberfläche zurück.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, alkalilösliche Polymerteilchen zu finden, die bei der Verarbeitung in alkalischen Verarbeitungsflüssigkeiten aus der Oberfläche entfernt werden. Hierzu sei auf die Druckschriften US-PS 2 322 037, GB-PS 878 520, US-PS 4 094 848, US-PS 4 142 894, GB-PS 2 012 978 und GB-PS 1 055 713 sowie auf die DE-OS 3 331 542 verwiesen.

15

20

25

30

10

Aus der DE-A-3 331 542 sind in alkalischem Medium lösliche Pfropfpolymerisate auf der Basis von Methacrylsäure und Methylmethacrylat auf Styrol-Maleinsäurehalbester Copolymerisaten als Pfropfgrundlage bekannt. Sie lösen sich in Abwesenheit von Gelatine beim Beguß bei pH-Werten um 6,2-6,5 teilweise. Die vorzeitige Auflösung der Teilchen ist insbesondere dann von Nachteil, wenn der Gießlösung Zusätze wie Kieselsole einverleibt werden, die aufgrund ihrer Herstellung und zum Zweck der Stabilisierung der Lösungen alkalisch eingestellt sind. Die Bruchfestigkeit und Oberflächenverschrammbarkeit der mit Kieselsolen versehenen Schichten wird stark verschlechtert. Aus der DE-A 33 33 142 ist weiterhin bekannt, zusätzlich Copolymerisate mit Polymethylmethacrylateinheiten zu verwenden.

Es wurde nun ein Aufzeichnungsmaterial gefunden, das eine Unterlage, wenigstens eine Schicht zur Aufzeichnung von

Informationen und gegebenenfalls weitere Schichten enthält, wobei wenigstens eine Schicht einen alkalilöslichen Abstandshalter sowie eine wasserunlösliche hochmolekulare Verbindung HM enthält, dadurch gekennzeichnet, daß die hochmolekulare Verbindung HM wiederkehrende Einheiten folgender Struktur enthält:

10

5

15

worin bedeuten

R¹,R²,R³: die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, Alkyl, insbesondere mit 1 bis 4 C-Atomen, Halogen, insbesondere Cl

20

L eine chemische Bindung oder ein übliches Bindeglied

25

X

eine reaktive Gruppe.

Unter einer reaktiven Gruppe wird eine Gruppe verstanden, die mit -NH2, -COOH oder -OH-Gruppen enthaltenden Substanzen in einer Additions- oder Kondensationsreaktion so reagieren kann, daß eine chemische Verknüpfung mit der entsprechenden Substanz erfolgen kann. Insbesondere handelt es sich hierbei um Gruppen, die mit Gelatine in der angegebenen Weise reagieren können.

35

Im allgemeinen enthält die Schicht weiterhin ein Bindemittel. Vorzugsweise entspricht das Verhältnis Bindemittel:hochmolekulare Verbindung HM:Abstandshalter den Werten 1:0,2 bis 5,0:0,3 bis 2,0, insbesondere etwa 1:1,1:0,5. Die Dicke der Schicht beträgt vorzugsweise 0,2 bis 5 μm.

10

5

Bevorzugte reaktive Gruppen X sind

$$-so_2$$
-ch=ch₂, -o-co-ch₂-cn,

$$-co_2N \xrightarrow{0}, -co_2N \xrightarrow{0}, -co_2N \xrightarrow{0},$$

$$-co_2$$
 $-co_2$ $-co_$

 $-co_2ch_2cn$, $-co_2ch_2co_2c_2h_5$, $-co_2ch_2conh_2$, $-co_2-ch_2coch_3$

$$-co_2ch_2co$$
, $-co_2ch_2co_2ch=ch_2$, $-co_2n=chch_3$,

15
$$-co_2N=c(cH_3)_2$$
, $-co_2C=chcooch_3$, $-co_2cH_2N$ ch_3 ch_3

R4 Alkyl, Aryl, Aralkyl.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform haben die wiederkehrenden Einheiten der hochmolekularen Verbindung HM folgende Struktur

worin

20

25

30

35 R¹, R², R³ und X die oben angegebene Bedeutung haben und worin

A-G 5098

L¹ eine -CONH-, -COO- oder eine Phenylengruppe ist,

5

L² eine Alkylengruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder Arylengruppe mit 6 bis 20 C-Atomen,

m O oder eine ganze Zahl ist.

n O oder eine ganze Zahl ist.

15

20

25

In einer weiteren besonderen Ausführungsform steht X für einen endständig mit Halogen-, Epoxy-, Imido-, -NCO-, -CH=CH₂-, -C(CH₃)=CH₂ oder CN-substituierten Rest. Besonders bevorzugte Beispiele für die wiederkehrenden Einheiten sind im folgenden angegeben:

30

In einer anderen besonders bevorzugten Ausführungsform sind in der hochmolekularen Verbindung HM zusätzlich zu den genannten wiederkehrenden Einheiten strukturell unterschiedene zusätzliche wiederkehrende Einheiten CM enthalten, die sich insbesondere von gegebenenfalls substituierten Acrylsäureestern, Methacrylsäureestern, Vinylaromaten und Acrylnitrilen ableiten. In einer bevorzugten Ausführungsform weien die hochmolekularen Verbindungen HM eine Glasübergangstemperatur von mindestens 50°C auf. Die Glasübergangstemperatur kann durch Wahl geeigneter Monomerer gezielt eingestellt werden.

Beispiele für Monomere CM sind in Polymer Handbook Abschnitt III "The Glass Transition Temperatures of Polymers" beschrieben. Einige Beispiele sind Ethylmethacrylat,

A-G 5098

25

30

Methylmethacrylat, Isobornylmethacrylat, Phenylmethacrylat, Cyclohexylchloracrylat, Methylchloracrylat, 4-tert.-5 Butylstyrol, 2,5-Dimethylstyrol, Styrol, Vinyltoluol, Acrylnitril, Methacrylnitril.

Beispiele für geeignete hochmolekulare Verbindungen sind, wobei der Monomeranteil in Gew.-% angegeben ist: 10

35

15

20

Unter alkalilöslischen Abstandshaltern werden vorzugsweise derartige Abstandshalter verstanden, die sich in den üblichen alkalischen Verarbeitungsbädern lösen. Insbesondere lösen sie sich bei pH-Werten oberhalb von pH 9,0. Die Abstandshalter weisen vorzugsweise eine mittlere Größe von 0,5 bis 6 μm, insbesondere von 1 bis 3 μm auf.

Es können die üblichen alkalilöslichen Abstandshalter verwendet werden, besonders bevorzugt sind Teilchen eines Pfropfcopolymerisates aus Methacrylsäure und Methacrylsäuremethylester auf der Pfropfgrundlage eines α -Olefinoder Styrol-Maleinsäurehalbamid- oder Maleinsäurecopolymerisates einer Teilchengröße von 0,5 bis 8 μ m und einer Teilchengrößenverteilung von \pm 1 μ m, die aus der DE-A-3 331 542 bekannt sind .

35

Weiterhin sind als alkalilösliche Abstandshalter Cellulosederivate geeignet, die mit Alkyl-hydroxyalkyl- und unter teilweiser Veresterung von Dicarbonsäuren substituiert sind. Weitere alkalilösliche Abstandshalter sind in US 2 992 101, US 4 094 848, US 4 142 894, GB 1 055 713 heschrieben.

10

Die Abstandshalter werden vorzugsweise in einer Menge von 30 bis 500 mg/m^2 , vorzugsweise $50 \text{ bis } 200 \text{ mg/m}^2$ je Schicht verwendet.

- Die erfindungsgemäß zu verwendenden hochmolekularen Verbindungen HM liegen vorzugsweise mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,02 bis 0,5 μm, insbesondere von 0,05 bis 0,20 μm, vor.
- Bei den erfindungsgemäß zu verwendenden wasserunlöslichen hochmolekularen Verbindungen HM handelt es sich vorzugsweise um Copolymere. Sie können hergestellt werden nach einem Emulsionspolymerisationsverfahren oder durch Polymerisation eines Monomeren in einem organischen Lösungsmittel und anschließendes Dispergieren der Lösung in Latexform in einer wäßrigen Lösung von Gelatine.

Die frei-radikalische Polymerisation eines ethylenisch ungesättigten Monomeren wird initiiert durch Zusatz eines freien Radikals, das gebildet wird durch thermische Zersetzung eines chemischen Initiators, durch Einwirkung eines Reduktionsmittels auf eine oxidierende Verbindung

35

(Redox-Initiator) oder durch physikalische Einwirkung, wie 5 Bestrahlung mit Ultraviolettstrahlen oder anderen hochenergetischen Strahlungen, hohen Frequenzen, usw. Beispiele für prinzipielle chemische Initiatoren umfassen ein Persulfat (beispielsweise Ammoniumpersulfat oder Kaliumpersulfat usw.), Wasserstoffperoxid, ein Peroxid (bei-10 spielsweise Benzoylperoxid oder tert. Butylperoctoat usw.) und eine Azonitrilverbindung (beispielsweise 4,4'-Azobis-4-cyanovaleriansaure und Azobisisobutyronitril, usw.), usw. Beispiele für konventionelle Redox-Initiatoren umfassen Wasserstoff-Eisen(II)-salz, Kaliumpersulfat, 15 Natriummetabisulfit und Cer IV-Salz-Alkohol, usw. Beispiele für die Initiatoren und deren Funktionen werden beschrieben von F.A. Bovey, in Emulsion Polymerization, Interscience Publishers Inc., New York, 1955, Seiten 59 bis 93. Als Emulgator, der bei der Emulsionspolymerisation 20 verwendet werden kann, wird eine Verbindung mit oberflächenaktiver Wirkung verwendet. Bevorzugte Beispiele dafür umfassen Seife, ein Sulfonat, ein Sulfat, eine kationische Verbindung, eine amphotere Verbindung und ein Schutzkolloid mit hohem Molekulargewicht. Spezielle Beispiele 25 für die Emulgatoren und deren Funktionen werden beschrieben in Belgische Chemische Industrie, Bd. 28, Seiten 16 bis 20, 1963.

30

Herstellungsbeispiel (hochmolekulare Verbindung B)

Unter Stickstoff wird eine Lösung aus 4 g Alkyldiphenyletherdisulfonat und 500 g Wasser auf 70°C erwärmt. Dann
dosiert man in 90 min gleichzeitig ein Gemisch aus 150 g
Methylmethacrylat und 40 g Chlorethylmethacrylat, eine
Lösung aus 1 g Kaliumperoxodisulfat in 50 g Wasser und
eine Lösung aus 0,5 g Natriummetabisulfit in 50 ml Wasser.
Man rührt 2 Stunden nach und stellt anschließend den pH
auf 7 ein und destilliert einen Teil des Wassers ab, so
daß ein Feststoffgehalt von 20 % erzielt wird.

15

10

Die die Abstandshalter und die hochmolekulare Verbindung HM enthaltenen Schichten sind vorzugsweise äußere Schichten, die im allgemeinen hydrophile Kolloide enthalten.

Als hydrophile Kolloide können dabei z.B. folgende Verbindungen dienen: Proteine, wie Gelatine, Gelatinederivate, z.B. acetylierte Gelatine, Phthaloyl-Gelatine oder Succinyl-Gelatine, Albumin, Kasein, Gummi-arabicum, Agar-Agar, Alginsäure, Cellulosederivate z.B. Alkylester von Carboxymethylcellulose, vorzugsweise die Methyl- oder Ethylester, Hydroxyethylcellulose, Carboxymethylcellulose, synthetische Polymerisate z.B. Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyacrylamid, Salze von Polyacrylsäure, Salze von Polymethacrylsäure, Salze von Polymethacrylsäure, vorzugsweise die Natriumoder Kaliumsalze sowie Mischpolymerisate, die mindestens eines der Monomeren der oben angegebenen Polymerisate

• 5

enthalten. Unter diesen hydrophilen Kolloiden haben
amphotere polymere Elektrolyte, wie Gelatine, Gelatinederivate, Kasein und andere Eiweißverbindungen, eine
besonders ausgeprägte Wirkung. Die hydrophilen Kolloide
können auch einzeln oder in Form einer Kombination verwendet werden. Zu bevorzugten Kolloiden gehören Gelatine,
Gelatinederivate, Kasein und andere Eiweißverbindungen.

Den Gießlösungen für diese Schichten können weiter 0,1 bis 1 Gew.-% oberflächenaktive Mittel, bezogen auf das Gewicht des anwesenden Wassers, zugesetzt werden. Beispiele für 15 geeignete oberflächenaktive Mittel sind Saponin und andere Verbindungen natürlichen Ursprungs, nichtionische oberflächenaktive Mittel, wie Polyalkylenoxide, Glycerinverbindungen wie Monoglyceride oder Glycidolverbindungen, anionische oberflächenaktive Mittel mit einer oder mehre-20 ren Säuregruppen, wie z.B. einer oder mehreren Carbonsäure-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Sulfonsäureester- oder Phosphorsäureester-Gruppen. Besonders geeignete oberflächenaktive Mittel werden in den US-PSen 2 271 623, 2 240 472, 2 288 226, 2 676 122, 2 676 924, 2 676 975, 25 2 691 566, 2 721 860, 2 730 498, 2 742 379, 2 739 891, 3 068 101, 3 158 484, 3 201 253, 3 210 191, 3 294 540, 3 415 649, 3 441 413, 3 442 654, 3 475 174 und 3 545 974, in der DE-OS 1 942 665 und in den GB-PSen 1 077 317 und 1 198 450 sowie in "Kaimen Kassei Zai no Gosei to Sono 30 Ohyo" (Synthesis and Application of Surface Active Agent) von Rychei Oda et al (publiziert von Maki Publishing Co, 1964), "Surface Active Agents" von J.W. Perry and A.M. Schwartz (publiziert von Interscience Publications Inc.,

1958), "Encyclopedia of Surface Active Agents", Band 2, von J.P. Sisley (publiziert von Chemical Publishing Co., 1964) "Kaimen Kassei Zai Binran (Surfactants Encyclopedia)", 6. Auflage (publiziert von Sangyo Tosho Co., 20.Dezember 1966) und dgl., beschrieben. Auch fluorhaltige Netzmittel, wie sie beispielsweise in der DE-OS 1 961 638 beschrieben werden, sind einsetzbar.

Diese oberflächenaktiven Mittel können ebenfalls allein oder in Form von Kombinationen verwendet werden und besonders geeignete Verbindungen sind solche mit einer OSO3M-Gruppe, wie z.B. Sulfonatester von gewöhnlichen Alkoholen der allgemeinen Formel R-O-SO3M oder R-(OCH2CH2)n-OSO3M (worin R eine Alkylgruppe mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen, M ein Alkalimetall- oder Ammoniumion und n eine positive ganze Zahl von bis zu 20 bedeuten) und Alkylbenzolsulfonsäureverbindungen mit der allgemeinen Formel

worin R' Wasserstoff oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, R" eine Alkylgruppe mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, M ein Alkalimetall- oder Ammoniumion, m eine positive ganze Zahl von 0 bis 20 und n die Zahl 3 oder 4 bedeuten.

35

30

15

Bei den erfindungsgemäßen Aufzeichnungsmaterialien handelt 5 es sich vorzugsweise um Materialien mit wenigstens einer lichtempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht. Die erfindungsgemäß zu verwendenden Schichten liegen vorzugsweise als äußerste Schichten vor, d.h. als äußerste Schicht auf der Vorderseite und/oder der Rückseite des 10 Materials. Es können die üblichen Silberhalogenidemulsionstypen verwendet werden, die vorzugsweise chemisch und spektral sensibilisiert sind. Im Material können weiterhin die üblichen Zusätze sein wie Aufheller, Antischleiermittel, Stabilisatoren, Filterschichten, Bindemittel, 15 Härtungsmittel, Weichmacher, Gleitmittel, Antistatika, Farbkuppler usw. Verwiesen wird hierzu auf die Research Disclosure 17643 aus 1978, Seite 22 bis 31; Research Disclosure 18716 aus 1979, Seiten 647 bis 651. Bei den Aufzeichnungsmaterialien kann es sich beispielsweise um 20 Colornegativ, Colorumkehr und um Papiermaterialien handeln. Diese können in an sich bekannter Weise bearbeitet werden. Verarbeitungsgänge für Farbumkehrmaterialien werden beispielsweise angegeben in der DE-A-3 113 009 und der DE-A-3 226 163. Die Verarbeitung von Colorpapier-**25** . materialien wird beispielsweise angegeben in der DE-A-3 107 173. Die Verarbeitung von Colornegativfilmen wird beispielsweise angegeben in der DE-A-3 029 209.

Die erfindungsgemäßen Schichten können dazu verwendet werden, den Gelatineschichten des fotografischen Materials das Härtungsmittel zuzuführen. Bei diesem bekannten Härtungsverfahren durch Überschichtung eines Härtungsmittels gelangt das Härtungsmittel durch Diffusion in die

tiefer liegenden Schichten. Es ist so möglich, z.B. ein farbfotografisches Mehrschichtenmaterial in einem Schritt zu härten. Gebräuchlich für diese Arbeitsweise sind vor allem die sogenannten schnellwirkenden Härtungsmittel. Als Beispiele für solche Härtungsmittel seien N-carbamoyl- und N-carbamoyloxipyridinium-Verbindungen (US-PS 3 880 665), Sulfogruppen enthaltende N-carbamoylpyridinium-Verbindungen in Form der freien Betaine oder deren Metallsalze (US-PS 4 036 952), 2-Alkoxy-N-carboxidihydrochinolinester (US-PS 4 013 468), Isoxazoliumsalze (US-PS 3 321 313) oder Carbodiimide (DE-PS 1 148 446 und DE-OS 2 439 553) genannt.

Unerwartet und überraschend war die gleichzeitige Verbesserung von Bruchfestigkeit und Naßkratzfestigkeit (Oberflächenverschrammbarkeit) durch die erfindungsgemäßen Verbindungen bei guter Antiklebewirkung. Normalerweise erzielt man mit Verbindungen, die die Klebewirkung verringern, wie z.B. Kieselsole, deutlich verringerte Bruchfestigkeit und Oberflächenverschrammbarkeit.

25

20

30

Beispiel

5

Es werden Gießlösungen für Deckschichten mit folgenden Substanzen hergestellt:

		A		В		С	
10	Gelatinelösung (15 gew%ig in Wasser)	200	g	200	g	400	g
	Wasser, entsalzt	2.700	g	2.650	g	2.650	g
15	polystyrolsulfonsaures Natrium (10 %ig in Wasser)	30	g	30	g	30	g
	Alkalilösliche Abstandshalter ¹⁾	15	g	15	g	15	g
	Kieselsol, 30 gew%ig in Wasser	150	g	-		-	
	Polymethylmethacrylat 20 gew%ig in Wasser	-		200	g	-	
20	hochmolekulare Verbindung B gemäβ Erfindung	-		-		200	g
	Silicongleitmittel, 30 gew%ig in Wasser	20	g	20	g	20	g
	Netzmittel, 4 gew%ig in Wasser	80	g	80	g	80	g
2:	Härtungsmittel, 5 gew%ig in Wasser	2.000	g	2.000	g	2,000	g

Als Abstandshalter wurde Pfropfcopolymerisat 1 der DE-A-3 331 542 verwendet.

30

Der pH-Wert der Lösungen beträgt 6,0 bis 6,5, der Na β auftrag 50 g/m².

Das Härtungsmittel entspricht der Formel

35
$$0 N-CO^{\Theta}-N$$
 $CH_2-CH_2-CH_2-OH$

A-G 5098

Die Deckschichtlösung wird auf einen ungehärteten Color-5 negativfilm gegossen und getrocknet.

Die Proben wurden nach der Trocknung in der aus der DE-A-3 331 542 angegebenen Weise auf Glanzstellen, Patronen-auszug, Gelbflecken und Körnigkeit geprüft. Weiterhin wurde der Bruchdurchmesser und die Naßkratzfestigkeit in N wie folgt bestimmt:

- a) Bruchfestigkeit

 Der Bruchdurchmesser der fotografischen Aufzeichnungsmaterialien wird gemessen wie in der Research
 Disclosure 25 302, Mai 1985 beschrieben.
- Naßkratzfestigkeit b) Die fotografischen Aufzeichnungsmaterialien befinden sich mit der Schichtseite nach oben auf einer horizontalen Probenhalterung in einem mit Wasser von 10° DH und 38° C gefüllten Wanne. Die zu messende 20 Probe ist völlig mit Wasser bedeckt. Nach 5-minütiger Quelldauer wird eine fest arretierte Stahlkugel (Ø 3,2 mm) mit einer Geschwindigkeit von v = 30 mm/sec über die Oberfläche des Prüflings geführt. Die Kraft (in N), mit der die obengenannte Stahlkugel 25 auf die äußerste Schutzschicht der Probe drückt, wird so eingestellt, daß sie auf einer Meßstrecke von 20 cm Länge kontinuierlich von 0 bis 10 N ansteigt. Als Maß für die Naßkratzfestigkeit des fotografischen Aufzeichnungsmaterials (in N) wird diejenige Kraft 30 angegeben, bei der nach Probentrocknung die erste Schichtverletzung auf der Meßstrecke mittels des menschlichen Auges erkennbar ist.
 - 35 Aus der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Werte ersichtlich:

A-G 5098

10

h- NaBkratz- festigkeit in N	κ κ	4 6	4,9
Bruchdurch- messer in mm	ω, 0	2,2	2,5
Körnig- keiten, å _D -Wert	8 -	9,1	1 8
Farb- flecken in %	0	0	D
Patronen- auszug in g	150-200	150-200	150-200
Glanz- stellen in %	S-0	0-5	0-5
	A (Vergl.)	B (Vergl.)	C (Erfdg.)

A-G 5098

Das erfindungsgemäße Material C zeigt bei gleicher Antiklebewirkung und gleicher Körnigkeitsbeeinflussung deutlich verbesserte Bruchfestigkeit bei verringerter Oberflächenverschrammbarkeit in gequollenem Zustand.

10

15

20

25

30

Patentansprüche

5

1. Fotografisches Aufzeichnungsmaterial, das eine Unterlage, wenigstens eine Schicht zur Aufzeichnung von Informationen und gegebenenfalls weitere Schichten enthält, wobei wenigstens eine Schicht einen alkalilöslichen Abstandshalter sowie eine wasserunlösliche hochmolekulare Verbindung HM enthält, dadurch gekennzeichnet, daß die hochmolekulare Verbindung HM wiederkehrende Einheiten folgender Struktur enthält:

15

10

20

worin bedeuten

 R^1 - R^3 die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, Alkyl oder Halogen,

25 Chemische Bindung oder ein übliches Bindeglied

X eine reaktive Gruppe.

30

2. Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die wiederkehrenden Einheiten folgender Struktur entsprechen

35

A-G 5098

worin

5

 \mathbb{R}^1 - \mathbb{R}^3 und X die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben und

worin

- L¹ eine -CONH-, -COO- oder eine Phenylengruppe ist,
- eine Alkylengruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder
 Arylengruppe mit 6 bis 20 C-Atomen,
 - eine -COO-, -OCO-, -CONH-, -NH-CO-O-, -NHCO-, -SO₂NH-, -NHSO₂-, -SO₂-Gruppe oder -O- ist,
- 20 m O oder eine ganze Zahl ist.
 - n O oder eine ganze Zahl ist.
- Material nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis
 2, dadurch gekennzeichnet, daß X für einen Rest steht, der endständig substituiert ist mit Halogen, Epoxy, Imido, -NCO, -CH=CH₂, -C(CH₃)=CH₂ oder CN.
- 4. Material nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis
 3, dadurch gekennzeichnet, daß die hochmolekulare
 Verbindung HM ein Copolymer ist, welches zusätzlich
 wiederkehrende Einheiten enthält, die sich ableiten
 von gegebenenfalls substituierten Acrylsäureestern,
 Methacrylsäureestern, Vinylaromaten oder Acrylnitrilen.

- 5. Material nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis
 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Material wenigstens eine lichtempfindliche Silberhalogenidemulsionsschicht enthält.
- 6. Material nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis
 5, dadurch gekennzeichnet, daß als alkalilöslicher
 Abstandshalter Teilchen eines Pfropfcopolymerisates
 aus Methacrylsäure und Methacrylsäuremethylester auf
 der Pfropfgrundlage eines α-Olefin- oder StyrolMaleinsäurehalbamid- oder Maleinsäurecopolymerisates
 verwendet wird.
 - 7. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als alkalilöslicher Abstandshalter ein substituiertes Cellulosederivat verwendet wird.
 - 8. Material nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die hochmolekulare Verbindung HM teilchenförmig mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,02 bis 0,5 μm vorliegen.
- 9. Material nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die hochmolekulare Verbindung HM ein Copolymer ist, welches eine Glasübergangstemperatur von mindestens 50°C aufweist.

20

10. Material nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht mit dem alkalilöslichen Abstandshalter und der wasserunlöslichen hochmolekularen Verbindungen HM eine äußere Schicht des fotografischen Aufzeichnungsmaterials ist.

A-G 5098